二酸化炭素標準ガスのうち窒素希釈のものであって、濃度が三体積百分率以上十六体積百分率以下のもの	二酸化炭素標準ガスであって、一般財団法人化学物質評価研究機構が保管する標準ガス製造装置を用いて製造されたもの
一酸化窒素標準ガスのうち窒素希釈のものであって、濃度が〇・〇五体積百万分率以上五体積百分率以下のもの	一酸化窒素標準ガスであって、一般財団法人化学物質評価研究機構が保管する標準ガス製造装置を用いて製造されたもの
二酸化窒素標準ガスのうち空気希釈のものであって、濃度が五体積百万分率以上五十体積百万分率以下のもの	二酸化窒素標準ガスであって、一般財団法人化学物質評価研究機構が保管する標準ガス製造装置を用いて製造されたもの
酸素標準ガスのうち窒素希釈のものであって、濃度が一体積百分率以下及び濃度が九十八体積百分率以上百体積百分率以下のもの	酸素標準ガスであって、一般財団法人化学物質評価研究機構が保管する標準ガス製造装置を用いて製造されたもの
二酸化硫黄標準ガスのうち窒素希釈のものであって、濃度が〇・一体積百万分率以上一体積百分率以下のもの及び空気希釈のものであって、濃度が〇・〇五体積百万分率以上〇・一体積百万分率以下のもの	二酸化硫黄標準ガスであって、一般財団法人化学物質評価研究機構が保管する標準ガス製造装置を用いて製造されたもの
アンモニア標準ガスのうち窒素希釈のものであって、濃度が二十体積百万分率以上百体積百万分率以下のもの	アンモニア標準ガスであって、一般財団法人化学物質評価研究機構が保管する標準ガス製造装置を用いて製造されたもの
ジクロロメタン標準ガスのうち窒素希釈のものであって、濃度が〇・一体積百万分率以上一体積百万分率以下のもの	ジクロロメタン標準ガスであって、一般財団法人化学物質評価研究機構が保管する標準ガス製造装置を用いて製造されたもの
クロロホルム標準ガスのうち窒素希釈のものであって、濃度が〇・一体積百万分率以上一体積百万分率以下のもの	クロロホルム標準ガスであって、一般財団法人化学物質評価研究機構が保管する標準ガス製造装置を用いて製造されたもの
トリクロロエチレン標準ガスのうち窒素希釈のものであって、濃度が〇・一体積百万分率以上一体積百万分率以下のもの	トリクロロエチレン標準ガスであって、一般財団法人化学物質評価研究機構が保管する標準ガス製造装置を用いて製造されたもの
テトラクロロエチレン標準ガスのうち窒素希釈のものであって、濃度が〇・一体積百万分率以上一体積百万分率以下のもの	テトラクロロエチレン標準ガスであって、一般財団法人化学物質評価研究機構が保管する標準ガス製造装置を用いて製造されたもの
一・二―ジクロロエタン標準ガスのうち窒素希釈のものであって、濃度が〇・一体積百万分率以上一体積百万分率以下のもの	一・二―ジクロロエタン標準ガスであって、一般財団法人化学物質評価研究機構が保管する標準ガス製造装置を用いて製造されたもの
ベンゼン標準ガスのうち窒素希釈のものであって、濃度が〇・一体積百万分率以上一体積百万分率以下のもの	ベンゼン標準ガスであって、一般財団法人化学物質評価研究機構が保管する標準ガス製造装置を用いて製造されたもの
一・三―ブタジエン標準ガスのうち窒素希釈のものであって、濃度が〇・一体積百万分率以上一体積百万分率以下のもの	一・三―ブタジエン標準ガスであって、一般財団法人化学物質評価研究機構が保管する標準ガス製造装置を用いて製造されたもの
アクリロニトリル標準ガスのうち窒素希釈のものであって、濃度が〇・一体積百万分率以上一体積百万分率以下のもの	アクリロニトリル標準ガスであって、一般財団法人化学物質評価研究機構が保管する標準ガス製造装置を用いて製造されたもの
塩化ビニル標準ガスのうち窒素希釈のものであって、濃度が〇・一体積百万分率以上一体積百万分率以下のもの	塩化ビニル標準ガスであって、一般財団法人化学物質評価研究機構が保管する標準ガス製造装置を用いて製造されたもの
o―キシレン標準ガスのうち窒素希釈のものであって、濃度が〇・一体積百万分率以上一体積百万分率以下のもの	o―キシレン標準ガスであって、一般財団法人化学物質評価研究機構が保管する標準ガス製造装置を用いて製造されたもの
m―キシレン標準ガスのうち窒素希釈のものであって、濃度が〇・一体積百万分率以上一体積百万分率以下のもの	m―キシレン標準ガスであって、一般財団法人化学物質評価研究機構が保管する標準ガス製造装置を用いて製造されたもの
トルエン標準ガスのうち窒素希釈のものであって、濃度が〇・一体積百万分率以上一体積百万分率以下のもの	トルエン標準ガスであって、一般財団法人化学物質評価研究機構が保管する標準ガス製造装置を用いて製造されたもの
エチルベンゼン標準ガスのうち窒素希釈のものであって、濃度が〇・一体積百万分率以上一体積百万分率以下のもの	エチルベンゼン標準ガスであって、一般財団法人化学物質評価研究機構が保管する標準ガス製造装置を用いて製造されたもの
空気の零位調整標準ガス又は窒素の零位調整標準ガスであってメタン濃度が〇・一体積百万分率以下、一酸化炭素濃度が〇・一体積百万分率以下、二酸化炭素濃度が百万分率以下、一体積百万分率以下、窒素濃度が〇・〇五体積百万分率以下及び二酸化硫黄濃度が〇・〇〇五体積百万分率以下のもの	空気の零位調整標準ガス及び窒素の零位調整標準ガスであって、一般財団法人化学物質評価研究機構が保管する標準ガス製造装置を用いて製造されたもの
窒素の零位調整標準ガスであって、ベンゼン濃度が〇・〇五体積十億分率以下、トリクロロエチレン濃度が〇・〇一体積十億分率以下、テトラクロロエチレン濃度が〇・〇一体積十億分率以下、クロロホルム濃度が〇・〇一体積十億分率以下、ジクロロメタン濃度が〇・一体積十億分率以下、一・二―ジクロロエタン濃度が〇・一体積十億分率以下、一・三―ブ	窒素の揮発性有機化合物測定用零位調整標準ガスであって、一般財団法人化学物質評価研究機構が保管する標準ガス製造装置を用いて製造されたもの